(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004年5月13日(13.05.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/039549 A1

(51) 国際特許分類7:

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/013587

(22) 国際出願日:

2003年10月23日(23.10.2003)

B28D 5/00, C03B 33/027

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願 2002-314173

2002年10月29日(29.10.2002)

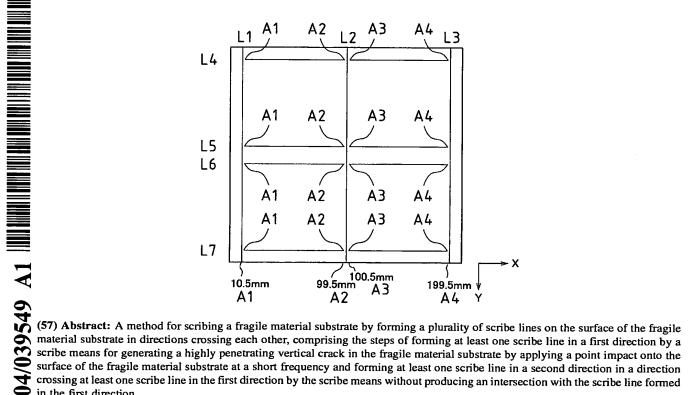
(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 三星ダ イヤモンド工業株式会社 (MITSUBOSHI DIAMOND INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒564-0044 大阪府 吹田市南金田2丁目12番12号 Osaka (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 前川 和哉 (MAEKAWA, Kazuya) [JP/JP]; 〒564-0044 大阪府 吹田 市南金田2丁目12番12号三星ダイヤモンド工業 株式会社内 Osaka (JP). 江島谷 彰 (EJIMATANI, Akira) [JP/JP]; 〒564-0044 大阪府 吹田市 南金田2丁目 12番12号 三星ダイヤモンド工業株式会社内 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 倉内 義朗 (KURAUCHI, Giro); 〒530-0047 大 阪府 大阪市 北区西天満 4 丁目 1 4番 3 号住友生命 御堂筋ビル Osaka (JP).
- (81) 指定国(国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR,

/続葉有/

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR SCRIBING FRAGILE MATERIAL SUBSTRATE

(54) 発明の名称: 脆性材料基板のスクライブ方法及びその装置



- crossing at least one scribe line in the first direction by the scribe means without producing an intersection with the scribe line formed in the first direction.
- (57) 要約: 本脆性材料基板のスクライブ方法は、脆性材料基板の表面に複数本のスクライブラインを互いに交差す る向きに形成する方法であり、脆性材料基板の表面に



LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

明 細 書

脆性材料基板のスクライブ方法及びその装置

5 技術分野

本発明は、フラットパネルディスプレイ(以下、FPDという)に使用されるガラス基板、或いは半導体ウエハやセラミックスといった各種脆性材料基板の分断に際し、脆性材料基板の表面に相互に交差する複数本のスクライブラインを形成する脆性材料基板のスクライブ方法及びスクライブ装置に関10 する。

背景技術

FPD関連の商品として、液晶表示パネル、液晶プロジェクター基板、有 機エレクトロルミネセンス素子などが、様々な用途において、画像及び文字 を含む表示手段として使用されている。そうしたFPDのうち、例えば、一 対のガラス基板を貼り合わせて形成される液晶表示パネルは、その製造過程 において、それぞれが大寸法の一対のマザーガラス同士が相互に貼り合わさ れた後に、所定の大きさになるように分断される。このマザーガラス基板の 分断には、まず、マザーガラス基板の表面に対してカッターホイールに荷重 20 をかけて一方向にカッターホイールを転動させる(走行させる)作業を走行 開始位置を順次ずらせながら所定回数繰り返し、これによって並行する第1 の方向のスクライブラインを形成してから、今度はカッターホイールの走行 方向をそれまでとは交差する方向に変えることで第1の方向のスクライブラ インと交差する第2の方向のスクライブラインを形成するといったクロスス クライブが行われる。そしてこのあと、上記のクロススクライブされたマザ ーガラス基板は、ブレークマシンに送られ、そこで該基板に対してスクライ ブラインを中心軸として所定の曲げ応力を印加することにより、スクライブ ラインに沿って分断され、これにより目的とする液晶表示パネルが得られる

このような脆性材料基板のクロススクライブを行うためのスクライブ装置に好適なカッターホイールとして、本願出願人は、先に、刃先稜線に微細な切り欠きを等間隔で設けることで突起を形成してなる「ガラスカッターホイール」(特許第3074143号公報:特許文献1参照)を開発した。このガラスカッターホイールを採用したスクライブ装置にあっては、スクライブ時の残留応力の発生を抑えるとともに、ブレーク後、ガラス分断面に不用な欠け(水平クラック)の発生を増大させることなく、ガラスを貫通するような高浸透の垂直クラックを得ることができる。

カッターホイールの刃先稜線に凹凸などの加工が何ら施されていないカッ ターホイールを採用したスクライブ装置を用いて脆性材料基板にクロススク ライブを実施すると、交点飛びと呼ばれる現象(最初に形成されたスクライ ブラインをカッターホイールが通過する付近で、後から形成されるべきスク ライブラインが形成されない現象)が発生する。この現象は最初に形成され たスクライブライン(垂直クラックのライン)の両側に応力が残存し、次に 最初に形成されたスクライブラインに交差してスクライブラインを形成する ときに、カッターホイールが上述の応力が残存している箇所で脆性材料基板 に垂直クラックを生成させるための脆性材料基板に対するカッターホイール の押圧力が削がれてしまうため、スクライブラインが形成されなくなってし まう現象であり、頻繁に発生していた。しかし、刃先稜線に微細な切り欠き 20 を等間隔で設けることで突起を形成してなるカッターホイールを備えたスク ライブ装置により、クロススクライブを行った場合、カッターホイールの稜 線部に形成された突起により脆性材料基板に打点衝撃が加えられ、上述の応 力が残存している箇所をカッターホイールが通過するときに、そのカッター ホイールの脆性材料基板に対する押圧力が削がれないため、従来周知の、刃 先稜線に凹凸などの加工が何ら施されていないカッターホイールを採用した スクライブ装置で見られたような、交点飛びと呼ばれる現象が発生せず、ま た高浸透の垂直クラックが得られるため、スクライブ後のブレークマシンに よる分断作業が何ら支障なく行えるといった利点があった。

ところが、上記特許文献1のカッターホイールを採用したスクライブ装置

では、脆性材料基板にスクライブラインを一方向にのみ形成するときは何ら問題はないが、前述したようなクロススクライブを行う場合(図26参照)、スクライブライン同士(L1~L3とL4~L7)の交点Sにおいて、図27乃至図29に示すような、当業界において、いわゆるカケ、コジリ、ソ5 ゲと呼ばれる不良が発生することがあった。

上記カケとは、図27に示すように、カッターホイールCが脆性材料基板 Gに圧接転動している側の基板が沈み込み(図中の矢符参照)、既設のスク ライブラインL1~L3にさしかかったところで、半分断状態にある反対側 の基板に乗り上げるときに発生(図中の符号αで示す)するものである。

10 また、コジリとは、図28に示すように、カッターホイールCが脆性材料 基板Gに圧接転動して、既設のスクライブラインL1~L3にさしかかる手 前で、半分断状態にある基板同士が競り合って、それぞれの端面部に発生す る微細なカケであり、これをコジリβという。

ソゲとは、図29に示すように、カッターホイールCが脆性材料基板Gに 15 圧接転動して、既設のスクライブラインL1~L3のいずれかにさしかかろうとするとき、半分断状態(垂直クラックKが脆性材料基板Gの厚みの約90%まで達している状態)のスクライブラインL1~L3が脆性材料基板Gの裏面近傍で斜め方向に分断されてしまう。この不具合をソゲγという。

上記したような各種の不良はいずれも、当然のことながら、製品の品質を 20 損ねるものであり、FPD基板の製造歩留りを低下させる原因となっていた

そこで、本発明者等は、上記の各問題点を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、特許文献1に開示したカッターホイールで脆性材料基板にスクライブを 行った場合に生じる特有の現象に着目し、本願発明を完成するに至った。

25 すなわち、本発明者等は、上記のカッターホイールによりスクライブを行った場合、スクライブ開始直後、カッターホイールの刃先稜線に形成された 突起によって、カッターホイール自体が脆性材料基板上をスリップせず、深い垂直クラックがスクライブ方向とは逆方向にも進展していくことが確認できた。図24及び図25は、その現象を示す模式図である。カッターホイー ルCに刃先荷重(図中矢符P参照)が加えられた状態でスクライブが開始(カッターホイールCは図25において時計回りに回転しながら矢符Tで示す方向に進行)され、負荷過程に入ると(図24①乃至③参照)、カッターホイールCは上記したように刃先稜線の突起によって脆性材料基板G上をスリップしないことから、カッターホイールCの回転移動に伴い脆性材料基板Gに垂直クラックKが生成されていく(図24②及び③参照)。このスクライブ開始直後に生成される高浸透の垂直クラックKがスクライブ方向とは逆方向に進展していくように形成されるのである。

また、スクライブ中は、カッターホイールの突起が脆性材料基板に打点衝撃を与えて垂直クラックKを形成していくため、形成される垂直クラック自体がスクライブ方向へ進展していくように形成される現象も見出した。この現象は、打点衝撃により脆性材料基板内に垂直クラックがスクライブ方向へ進展していくエネルギーが蓄積され、スクライブ停止後も垂直クラックの先端がさらに該停止位置よりも先に向かって伸長することとなり、その結果、15 高浸透の垂直クラックがスクライブ方向へ進展していくように形成されるのである。

そこで、本発明者等は、上記したような垂直クラックの進展現象を利用することで、クロススクライブの場合、既設の第1の方向のスクライブラインの近傍からスクライブを開始すれば、上記した前者の現象により垂直クラッ20 クが該既設の第1の方向のスクライブラインに達すること、及び、既設の第1の方向の次のスクライブラインの近傍でスクライブを終了すれば、上記した後者の現象により垂直クラックが該既設の第1の方向の次のスクライブラインに達することをそれぞれ予想し、それらを実験により確認した。

また、本発明者等は、上記のカッターホイールでクロススクライブを行う 25 場合、第1の方向の少なくとも一つのスクライブラインを形成する際にカッターホイールに加えた荷重よりも、第1の方向のスクライプラインと交差する第2の方向の少なくとも一つのスクライブラインを形成する際にカッターホイールに加える荷重を小さくすると、前述したような、カケやコジリ、ソゲといった不具合が一切生じないことも実験により見出した。



本発明は、前記従来の問題点を解決すべく、上記したような知見に基づき 創案されたものであり、相互に交差するスクライブラインを、前記したよう なスクライブライン交点に発生しがちな不具合を招来することなく形成しう るスクライブ方法及びスクライブ装置を提供するものである。

5

発明の開示

上記の目的を達成するため、本発明に係る脆性材料基板のスクライブ方法は、脆性材料基板の表面に複数本のスクライブラインを互いに交差する向きに形成する脆性材料基板のスクライブ方法であって、脆性材料基板の表面に10 短周期の打点衝撃を与えることで脆性材料基板内に高浸透の垂直クラックを生成させるスクライブ手段により第1の方向の少なくとも一つのスクライブラインを形成した後、この第1の方向の少なくとも一つのスクライブラインと交差する方向に沿う第2の方向の少なくとも一つのスクライブラインを、前記スクライブ手段により前記第1の方向のスクライブラインとの間で交点を作らずにスクライブすることで形成することを特徴とするものである。

また、本発明に係るスクライブ装置は、上記したスクライブ方法を実施するスクライブ装置であって、脆性材料基板の表面に短周期の打点衝撃を与えることで脆性材料基板内に高浸透の垂直クラックを生成させるスクライブ手段と、このスクライブ手段により前記第2の方向に少なくとも一つのスクライブラインを形成する際、該スクライブ手段を、前記第1の方向に形成されたスクライブラインを回避させつつ走行させる走行制御手段を備えたことを特徴とするものである。

このようなスクライブ方法及びスクライブ装置によれば、第2の方向のスクライブラインを形成するためのスクライブを第1の方向のスクライブラインの近傍位置から開始した直後に、前述したような垂直クラックの進展現象によって垂直クラックが該第1の方向のスクライブラインに達し、また、次の第1の方向のスクライブラインに到達する直前でスクライブを停止することで、上記現象により垂直クラックが該次の第1の方向のスクライブラインに達する。このように、短周期の打点衝撃を脆性材料基板に与えるスクライ

ブ手段により第1の方向の少なくとも一つのスクライブラインとの間で交点を作らずにスクライブすることで、すなわち、スクライブ手段を、第1の方向のスクライブラインを回避させつつ走行させることで、結果的に第1の方向のスクライブラインと第2の方向のスクライブラインとの交点にスクライブ手段からの負荷がかかることがなくなり、各第1の方向の少なくとも一つのスクライブラインと交差する第2の方向の少なくとも一つのスクライブラインが、前述したカケ、コジリ、ソゲといった不良を伴うことなく形成されることになるのである。

また、本発明に係る別のスクライブ方法は、脆性材料基板の表面に複数本のスクライブラインを相互に交差させて形成する脆性材料基板のスクライブ方法であって、脆性材料基板の表面に短周期の打点衝撃を与えることで脆性材料基板内に高浸透の垂直クラックを生成させるスクライブ手段により、脆性材料基板の表面に、第1の方向の少なくとも一つのスクライブラインと、この第1の方向の少なくとも一つのスクライブラインと交差する第2の方向の少なくとも一つのスクライブラインとを順次形成するにあたり、前記第1の方向に少なくとも一つのスクライブラインを形成する際に前記スクライブ 手段にかける荷重P1と、前記第2の方向に少なくとも一つのスクライブラインを形成する際に前記スクライブラインを形成する際に前記スクライブ手段にかける荷重P2との関係を、P1>P2としたことを特徴とするものである。

20 また、本発明に係る別のスクライブ装置は、上記した別のスクライブ方法を実施するスクライブ装置であって、脆性材料基板の表面に短周期の打点衝撃を与えることで脆性材料基板内に高浸透の垂直クラックを生成させるスクライブ手段と、前記第1の方向にスクライブラインを形成するときの前記スクライブ手段にかける荷重P1と、前記第2の方向にスクライブラインを形成するときの前記スクライブ手段にかける荷重P2との関係が、P1>P2となるようにスクライブ手段にかける荷重を制御する荷重制御手段とを備えたことを特徴とするものである。

このようなスクライブ方法及びスクライブ装置によれば、前述したような 、カケやコジリ、ソゲといった不具合は一切生じない。



したがって、前述したFPDの製品歩留りを向上させることができる。

図面の簡単な説明

図1は、本発明の実施の形態におけるスクライブ装置の一例を示す概略正 5 面図である。

図2は、本発明において使用されるカッターホイールの一例を示す図であり、同図(a)は回転軸方向から見たカッターホイールの外観側面図、同図(b)は回転軸と直角な方向から見たカッターホイールの外観正面図、同図(c)は同図(a)に示す刃先稜線部Aの拡大図である。

10 図3は、図2に示すカッターホイールにより脆性材料基板をスクライブした時に生じる垂直クラックを示す拡大断面図である。

図4は、カッターホイールの他の例を示す部分拡大図である。

図5は、カッターホイールのさらに他の例を示す部分拡大図である。

図6は、カッターホイールの他の例を示す部分拡大図である。

15 図7は、本発明によるスクライブ方法を説明する脆性材料基板の平面図である。

図8は、本発明によるスクライブ方法を説明する脆性材料基板の平面図である。

図9は、本発明によるスクライブ方法を説明する脆性材料基板の部分拡大 20 平面図である。

図10は、本発明の実施例を説明する脆性材料基板の平面図である。

図11は、本発明の実施例1において発生するソゲの大きさを説明する部 分拡大平面図である。

図12は、本発明の実施例1において発生するカケの大きさを説明する部 25 分拡大平面図である。

図13は、本発明の実施例1におけるカッターホイールの脆性材料基板 (ガラス板) に対する設定深さを説明する部分拡大側面図である。

図14は、本発明の実施例1におけるソゲの発生率を示すレーダーチャートである。

図15は、本発明の実施例1におけるソゲの発生率を示すレーダーチャートである。

図16は、本発明の実施例1におけるカケの発生率を示すレーダーチャートである。

5 図17は、本発明の実施例1におけるカケの発生率を示すレーダーチャートである。

図18は、本発明の実施例1におけるコジリの発生率を示すレーダーチャートである。

図19は、本発明の実施例2におけるソゲの発生率を示すレーダーチャー 10 トである。

図20は、本発明の実施例2におけるソゲの発生率を示すレーダーチャートである。

図21は、本発明の実施例2におけるカケの発生率を示すレーダーチャートである。

15 図22は、本発明の実施例2におけるカケの発生率を示すレーダーチャートである。

図23は、本発明の実施例2におけるコジリの発生率を示すレーダーチャートである。

図24は、図2のカッターホイールでスクライブしたときに脆性材料基板 20 に形成される垂直クラックの進展現象を説明する概略断面図である。

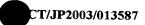
図25は、図2のカッターホイールでスクライブしたときに脆性材料基板 に形成される垂直クラックの進展現象を説明する図である。

図26は、従来のスクライブ方法におけるクロススクライブを説明するための脆性材料基板の平面図である。

25 図27は、従来のスクライブ方法により発生するカケを説明する図である

図28は、従来のスクライブ方法により発生するコジリを説明する図である。

図29は、従来のスクライブ方法により発生するソゲを説明する図である



発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施の形態について図を参照して説明する。

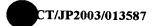
図1は、本発明の実施の形態におけるスクライブ装置を示す概略正面図で 5 ある。

このスクライブ装置は、載置された脆性材料基板Gを例えば真空吸引手段 によって吸着固定する水平回転可能なテーブル1と、このテーブル1をY方 向(紙面に直交する方向)に移動可能に支承する平行な一対の案内レール2 , 2と、この案内レール2, 2に沿ってテーブル1を移動させるボールネジ 10 3と、Y方向と直交するX方向(この図における左右方向)に沿ってテーブ ル1の上方に架設されたガイドバー4と、このガイドバー4にX方向に摺動 可能に設けられたスクライブヘッド5と、このスクライブヘッド5を摺動さ せるモータ6と、スクライブヘッド5の下部に昇降動可能且つ首振り自在に 設けられたチップホルダ7と、このチップホルダ7の下端に回転可能に装着 されたカッターホイール8と、ガイドバー4の上方に設置されテーブル1上 15 の脆性材料基板Gに記載されたアラインメントマークを認識する一対のCC Dカメラ9と、第2のスクライブラインを形成する際、上記カッターホイー ル8を第1のスクライブラインを回避させつつ走行させるべく上記スクライ ブヘッド5の摺動動作及びチップホルダ7の昇降動作を制御するソフトウエ 20 アで構成される走行制御手段とを備えたものである。

なお、上記したスクライブ装置は一例であって、スクライブヘッド5が固定され、テーブル1がX及びY方向に移動するタイプや、テーブル1が固定され、スクライブヘッド5がX及びY方向に移動するタイプのものであってもよい。

25 図2に示すカッターホイール8(8A)は脆性材料基板Gの表面に短周期の打点衝撃を与えうるタイプのものである。図2(a)は回転軸方向から見たカッターホイール8の外観側面図であり、図2(b)は回転軸と直角な方向から見たカッターホイール8の外観正面図である。また、図2(c)は刃先稜線部Aの拡大図である。ここでは、カッターホイール8Aの刃先稜線1

25



0に、図8(c)に示すように、U字形状の溝11を切り欠くことで、高さ hの突起12をピッチPの間隔で得ている。

ここで例示したカッターホイール $8 \, \mathrm{A}$ は、ホイール径 ϕ が $2.5 \, \mathrm{mm}$ 、ホイール厚Wが $0.65 \, \mathrm{mm}$ 、刃先角度 $2 \, \theta$ が $1.25 \, \mathrm{s}$ 、突起数が $1.25 \, \mathrm{d}$ 、

5 突起の高さhが 5μ m、ピッチPが 63μ mであり、このカッターホイール 8を用い、刃先荷重0. 35N、スクライブ速度300mm/secの条件で1. 1mm厚のガラス板をスクライブした時のガラス断面を図3に示している。

図3において、ガラス板の上面にある圧痕Lは、カッターホイール8をガ10. ラス板Gの上面を圧接転動させたときに生じたものであり、これをスクライブラインと称している(このラインは紙面に対し垂直方向に延在する)。このスクライブラインLの刻設と同時に、このスクライブラインLから直下方向に延びるクラック(垂直クラック) Kが発生するが、この場合、ガラス板を板厚方向にほぼ貫通するような長いクラック(実測962 μm)が発生、つまり 高浸透の垂直クラックが発生している。

このように、上記したカッターホイール8は、刃先荷重を大きくしても、水平クラックの発生はなく、その荷重の大きさに比例するように高浸透の垂直クラックKが得られる。このようにスクライブ時に得られる垂直クラックKが高浸透であると、次工程のブレイク作業において、スクライブラインに20 沿った正確なブレイクが行え、歩留りが向上する。又、ブレイク作業が容易なことから、ブレイク工程の内容を緩和あるいは簡素化できる。

図4~図6は他のカッターホイールの円周稜線部を示す部分拡大図である。図4のカッターホイール8Bは、上記のカッターホイール8Aとは異なる形状を有する突起121の例を示しており、刃先稜線101にV字形状の溝111を切り欠くことで突起121を形成している。

図5に示すカッターホイール8Cは、カッターホイール8A、8Bとさらに異なる形状を有する突起122の例を示しており、刃先稜線102に鋸形状の溝112を切り欠くことで突起122を形成している。

図6に示すカッターホイール8Dは上記カッターホイールとは異なる形状



を有する突起123の例を示しており、刃先稜線103に矩形の溝113を 切り欠くことで突起123を形成している。

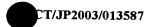
次に、前記走行制御手段によるスクライブヘッド5の摺動動作及びチップ ホルダ7の昇降動作の制御について、3本の第1のスクライブラインと、こ 5 れらと交差する4本の第2のスクライブラインとを形成する場合を例に採り 、図7乃至図9を参照して説明する。

まず、スクライブに先立ち、第1のスクライブラインL1~L3の形成位置及び相互の間隔、及び、第2のスクライブラインL4~L7の形成位置及び相互の間隔、並びに各第2のスクライブラインL4~L7のそれぞれについて第1のスクライブラインL1~L3の各間におけるスクライブ開始位置及びスクライブ停止位置の各情報をそれぞれパラメータとして、走行制御手段を構成するソフトウエアが搭載された図示しないコンピュータに入力する

すなわち、図7に示すように、第1のスクライブラインL1~L3の各形 は位置及び相互の間隔を決める値として、脆性材料基板Gの左上角を基準点 Oとし、この基準点OからのX方向(図7及び図8において右方向)への離 間距離を上記コンピュータに入力する。ここでは、説明を簡単にするために、スクライブラインL1は基準点からX方向に10mm、スクライブライン L2は同様に100mm、スクライブラインL3は同様に200mmと、単 20 純な値としている。

次に、第2のスクライブラインL4~L7の各形成位置及び相互の間隔を 決める値として、前記基準点からのY方向(図7及び図8において下方向) への離間距離を適宜前記コンピュータに入力する。

続いて、第2のスクライブラインL4~L7のそれぞれについて、第1の スクライブラインL1とL2の間におけるスクライブ開始位置A1を決める 値として、第1のスクライブラインL1の基準点Oからの離間距離に所定距離だけ加算した値(図8に示す例では10.5mm)を上記コンピュータに入力する。また、第1のスクライブラインL2とL3の間におけるスクライブ開始位置A3を決める値として、第1のスクライブラインL2の基準点O



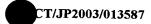
からの離間距離に所定距離だけ加算した値(図8に示す例では100.5mm)を上記コンピュータに入力する。ここでは、第1のスクライブラインL 1及びL2からそれぞれ0.5mmだけX方向へ離間した位置を第2のスクライブラインL4~L7におけるスクライブ開始位置としている。

- 5 また、第2のスクライブラインL4~L7のそれぞれについて、第1のスクライブラインL1とL2の間におけるスクライブ停止位置A2を決める値として、第1のスクライブラインL2の基準点Oからの離間距離より所定距離だけ減算した値(図8に示す例では99.5 mm)を上記コンピュータに入力する。また、第1のスクライブラインL2とL3の間におけるスクライ
- 10. ブ停止位置A4を決める値として、第1のスクライブラインL3の基準点Oからの離間距離より所定距離だけ減算した値(図8に示す例では199.5mm)を上記コンピュータに入力する。ここでは、第1のスクライブラインL2及びL3からそれぞれ0.5mmだけX方向とは逆方向へ離間した位置を第2のスクライブラインL4~L7におけるそれぞれのスクライブ停止位15 置としている。

図9は、第1のスクライブラインL1とL2との間におけるスクライブ開始位置A1と停止位置A2とを示す部分拡大図である。上記の例では、第1のスクライブラインL1とスクライブ開始位置A1との距離B1、及び、第1のスクライブラインL2とスクライブ停止位置A2との距離B2を、それ20 ぞれ0.5mmとしているが、この値は、脆性材料基板Gの材質や厚み、スクライブ時の刃先荷重等に応じて適宜調整されるものであり、実際のところ、およそ0.5mm~0.7mm程度とするのが好ましい。

なお、上記した各値の入力の順番は任意であり、上記した例に限定されない。また、前記基準点〇の位置も、脆性材料基板Gの左上角である必要はな 25 く、他の任意の角であっても、あるいは角以外、例えば任意の辺の中央といった既知の所定位置であってもよい。

以上のようにして第1及び第2の各スクライブラインL1~L7について スクライブ位置等の各値の設定が完了したならば、スクライブに入る。スク ライブが開始されると、まず、上記入力値に従い、脆性材料基板G上に第1



のスクライブラインL1~L3が形成される。

これが完了すると、前記したテーブル1が90度回転し、第2のスクライブラインL4~L7のスクライブが開始されるのであるが、このとき、前記スクライブへッド5は、上記制御手段により制御されて、第2のスクライブラインL4の開始位置の上方まで上記ガイドバー4に沿って摺動し、当該位置に達したら一旦停止して上記チップホルダ7が下降する。これによって、チップホルダ7に設けられたカッターホイール8が前述したスクライブ開始位置A1に降りる。このあと、カッターホイール8に刃先荷重がかけられ、その状態でスクライブへッド5が次の第1のスクライブラインL2に向かって摺動する。スクライブへッド5が摺動を開始しスクライブが始まると、前述したように、カッターホイール8によって脆性材料基板Gに高浸透の垂直クラックがスクライブ方向とは逆方向、つまり第1のスクライブラインL1に向かう方向に進展し、その結果、第2のスクライブラインL4の開始端が第1のスクライブラインL1に達することとなる。

たがてカッターホイール8が所定の位置、つまり第1のスクライブラインL2の手前に設定されたスクライブ停止位置A2に達すると、スクライブへッド5が停止し、引き続きチップホルダ7が上昇して脆性材料基板Gからカッターホイール8が離脱する。カッターホイール8が停止位置A2に達した時点で、前述したように、スクライブ停止後も垂直クラックの先端がさらに 該停止位置よりも先に向かって伸長し、高浸透の垂直クラックがスクライブ方向へ進展していくように形成され、その結果、第2のスクライブラインL4の終端が第1のスクライブラインL2に達することとなる。

チップホルダ7の上昇が完了したならば、スクライブヘッド5が再びX方向に向かって摺動し、第1のスクライブラインL2の上方を通過する。そして、スクライブヘッド5が第1のスクライブラインL2とL3との間におけるスクライブ開始位置A3の上方まで達したら一旦停止し、再びチップホルダ7が下降する。これによって、カッターホイール8が所定のスクライブ開始位置A3、すなわち第1のスクライブラインL2から所定距離だけX方向に離間した位置に降りる。このあと、再度カッターホイール8に刃先荷重が

25



かけられ、その状態でスクライブヘッド5が最終の第1のスクライブライン L3に向かって摺動する。

カッターホイール8が所定の位置、つまり第1のスクライブラインL3の手前に設定されたスクライブ停止位置A4に達すると、スクライブヘッド5が停止し、引き続きチップホルダ7が上昇して脆性材料基板Gからカッターホイール8が離脱する。以上で、第2のスクライブラインL4のスクライブを完了する。このあと、順次残りの第2のスクライブラインL5~L7についても上記と同様にして形成する。

なお、上記した実施の形態においては、スクライブ手段として、スクライ 10 ブヘッド 5、チップホルダ 7、カッターホイール 8 等から構成されたものを 例示したが、脆性材料基板 G の表面に短周期の打点衝撃を与えうるものであれば、他の構成のものであってもよい。

例えば、脆性材料基板Gの表面に押圧したカッタに、振動アクチュエータの周期的伸縮に伴う振動を加えてカッタに付与される押圧力(荷重)を周期15 的に大きくし、これによって脆性材料基板Gに打点衝撃を与えるようにしたものであってもよい。その一例として、特許第2954566号公報に開示されている装置があるので、ここでは詳述しない。

次に、請求項3及び4に係る発明の実施の形態について説明する。

スクライブ装置の形態は、上記の実施の形態において説明したものと基本 20 的に同様であるので、ここでは異なる点についてのみ説明する。

上記の実施の形態では、第2のスクライブラインを形成する際、上記カッターホイールを第1のスクライブラインを回避させつつ走行させるべく上記スクライブへッドの摺動動作及びチップホルダの昇降動作を制御するソフトウエアで構成される走行制御手段を備えていたが、本実施の形態においては、該走行制御手段に変えて、ソフトウエアで構成される荷重制御手段を備えている。

この荷重制御手段は、第1のスクライブラインを形成するときのカッターホイールに対する刃先荷重P1と、第2のスクライブラインを形成するときのカッターホイールに対する刃先荷重P2との関係が、P1>P2となるよ



うにカッターホイールにかける荷重を制御するものである。

このような荷重制御手段を備えたことにより、クロススクライブ時に、前述したような、カケやコジリ、ソゲといった不具合は一切生じないものとなった。

5 次に、実施例について説明する。

(実施例1)

脆性材料基板として、板厚 0.7 mmのガラス板に対し、図 10に示すように、各 5本ずつ、第 1のスクライブラインL 1~L 5 及び第 2のスクライブラインL 6~L 10をスクライブし、これら第 1 及び第 2のスクライブラ 10・インの合計 2 5ヶ所に亘る交点すべてについて、前述したソゲ、カケ、コジリのそれぞれの発生率を調べた。なお、以下においていうソゲの大きさとは、図 1 1において符号mで示す寸法をいい、カケの大きさとは、図 1 2 において符号nで示す寸法をいう。

スクライブの条件としては、カッターホイールの走行速度を300mm/15 secとし、カッターホイールがガラス板に乗り上げる前の設定深さ(図13の符号 d 参照)、すなわち切り込み量を0.15mmとした。なお、図中の符号 8 はカッターホイール、G ´ はガラス板を示す。また、第1のスクライブラインL1~L5を形成する際のカッターホイールにかける刃先荷重P1の設定値を、0.15MPa、0.20MPa、0.25MPa、0.30

20 MPaの4種類とする一方、第2のスクライブラインL6~L10を形成する際のカッターホイールにかける刃先荷重P2の設定値を、0.15MPa、0.20MPa、0.25MPa、0.30MPaの4種類とした。

上記に従ってスクライブした結果を図14乃至図18のレーダーチャート に示す。

25 図14は、大きさが100~200 μ mのソゲの発生率を、図15は、大きさが200~300 μ mのソゲの発生率を、図16は、大きさが150~300 μ mのカケの発生率を、図17は、大きさが300 μ m以上のカケの発生率を、図18は、コジリの発生率をそれぞれ示している。

これらの図からも明らかなように、第1のスクライブラインL1~L5を



形成するときのカッターホイールに対する刃先荷重P1と、第2のスクライブラインL6~L10を形成するときのカッターホイールに対する刃先荷重P2との関係を、P1>P2となるようにすると、上記のソゲ、カケ、コジリのいずれも発生率が低下することが判る。

5 (実施例2)

カッターホイールの走行速度を100mm/secとし、第1のスクライブラインL1~L5を形成する際のカッターホイールにかける刃先荷重P1の設定値を、0.15MPa、0.20MPa、0.25MPaの3種類とする一方、第2のスクライブラインL6~L10を形成する際のカッターホイ10 ールにかける刃先荷重P2の設定値を、0.15MPa、0.20MPa、0.25MPaの3種類とした以外、上記実施例1と同じ条件でスクライブを行った。

その結果を図19乃至図23のレーダーチャートに示す。

図19は、大きさが $100\sim200\mu$ mのソゲの発生率を、図20は、大15 きさが $200\sim300\mu$ mのソゲの発生率を、図21は、大きさが $150\sim300\mu$ mのカケの発生率を、図22は、大きさが 300μ m以上のカケの発生率を、図23は、コジリの発生率をそれぞれ示している。

これらの図からも明らかなように、第1のスクライブラインL1~L5を 形成するときのカッターホイールにかける刃先荷重P1と、第2のスクライ 20 ブラインL6~L10を形成するときのカッターホイールにかける刃先荷重 P2との関係を、P1>P2となるようにすると、上記のソゲ、カケ、コジ リのいずれも発生率が低下することが判る。

なお、上記した実施の形態においては、スクライブ手段として、スクライブへッド5、チップホルダ7、カッターホイール8等から構成されたものを例示したが、脆性材料基板Gの表面に短周期の打点衝撃を与えうるものであれば、他の構成のものであってもよい。

例えば、脆性材料基板Gの表面に押圧したカッタに、振動アクチュエータの周期的伸縮に伴う振動を加えてカッタに付与される押圧力(荷重)を周期的に大きくし、これによって脆性材料基板Gに打点衝撃を与えるようにした



ものであってもよい。その一例として、特許第2954566号公報に開示 されている装置があるので、ここでは詳述しない。

尚、上述の説明においては、脆性材料基板の一種であるガラス基板にスクライブラインを形成する場合について主に述べたがこれに限ることなく、例 えば、液晶表示パネル、プラズマディスプレイパネル(PDP)、有機ELディスプレイなどの脆性材料基板を貼り合わせたフラットパネルディスプレイ(FPD)や、透過型プロジェクタ基板、反射型プロジェクタ基板等のマザー貼り合わせ基板にスクライブラインを形成する工程にも本発明のスクライブ装置およびスクライブ方法が有効に適用される。

10

産業上の利用可能性

本発明のスクライブ装置およびスクライブ方法は、脆性材料基板としてガラス基板、脆性材料基板を貼り合わせたFPDやマザー貼り合わせ基板などに適用され、これらの基板に形成されたスクライブラインの交点に発生しが55な不具合を招来することなくスクライブラインを形成するのに有用である



請 求 の 範 囲

- 1. 脆性材料基板の表面に複数本のスクライブラインを互いに交差する向きに形成する脆性材料基板のスクライブ方法であって、
- 5 脆性材料基板の表面に短周期の打点衝撃を与えることで脆性材料基板内に高浸透の垂直クラックを生成させるスクライブ手段により第1の方向に少なくとも一つのスクライブラインを形成した後、この第1の方向の少なくとも一つのスクライブラインと交差する方向に沿う第2の方向の少なくとも一つのスクライブラインを、前記スクライブ手段により前記第1の方向のスクライブラインとの間で交点を作らずにスクライブすることで形成することを特徴とする脆性材料基板のスクライブ方法。
 - 2. 請求項1に記載のスクライブ方法を実施するスクライブ装置であって、 脆性材料基板の表面に短周期の打点衝撃を与えることで脆性材料基板内に 高浸透の垂直クラックを生成させるスクライブ手段と、
- 15 このスクライブ手段により前記第2の方向に少なくとも一つのスクライブラインを形成する際、該スクライブ手段を、前記第1の方向に形成されたスクライブラインを回避させつつ走行させる走行制御手段を備えたことを特徴とする脆性材料基板のスクライブ装置。
- 3. 脆性材料基板の表面に複数本のスクライブラインを相互に交差させて形 20 成する脆性材料基板のスクライブ方法であって、

脆性材料基板の表面に短周期の打点衝撃を与えることで脆性材料基板内に高浸透の垂直クラックを生成させるスクライブ手段により、脆性材料基板の表面に、第1の方向の少なくとも一つのスクライブラインと、この第1の方向の少なくとも一つのスクライブラインと交差する第2の方向の少なくとも一つのスクライブラインとを順次形成するにあたり、前記第1の方向に少なくとも一つのスクライブラインを形成する際に前記スクライブ手段にかける荷重P1と、前記第2の方向に少なくとも一つのスクライブラインを形成する際に前記スクライブラインを形成する際に前記スクライブ手段にかける荷重P2との関係を、

P1 > P2

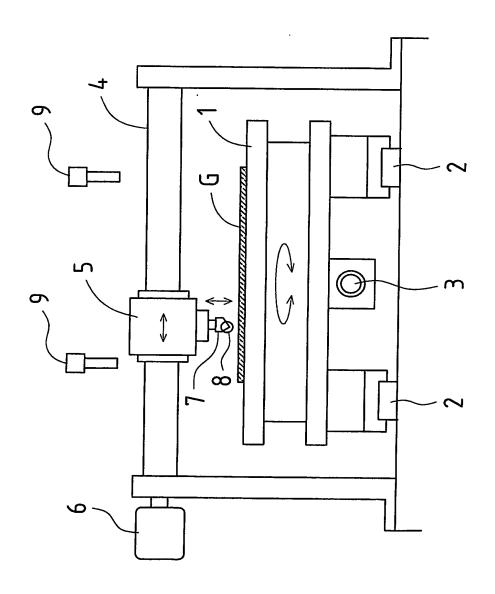


としたことを特徴とする脆性材料基板のスクライブ方法。

- 4. 請求項3に記載のスクライブ方法を実施するスクライブ装置であって、 脆性材料基板の表面に短周期の打点衝撃を与えることで脆性材料基板内に 高浸透の垂直クラックを生成させるスクライブ手段と、
- 5 前記第1の方向にスクライブラインを形成するときの前記スクライブ手段 にかける荷重P1と、前記第2の方向にスクライブラインを形成するときの 前記スクライブ手段にかける荷重P2との関係が、

P1 > P2

となるようにスクライブ手段にかける荷重を制御する荷重制御手段とを備え 10 たことを特徴とする脆性材料基板のスクライブ装置。



2/23

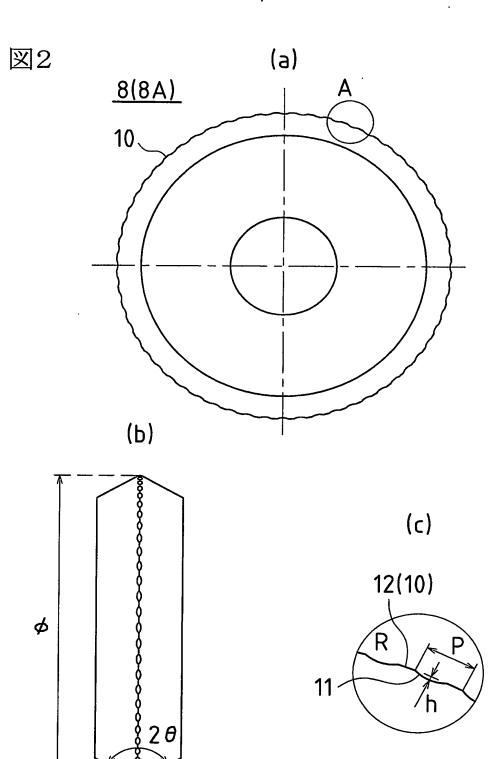
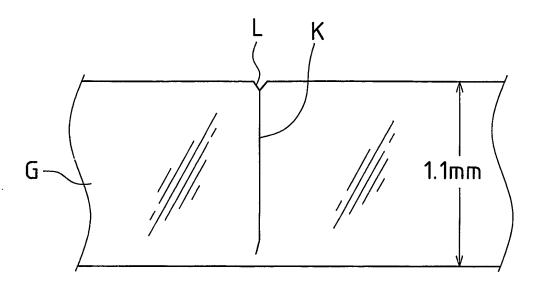


図3



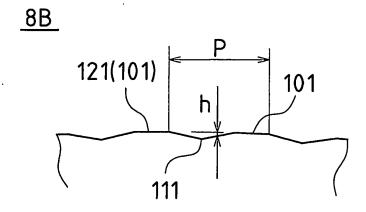
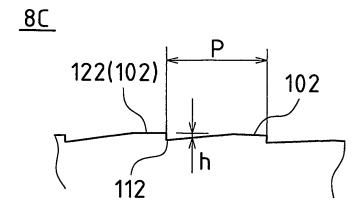
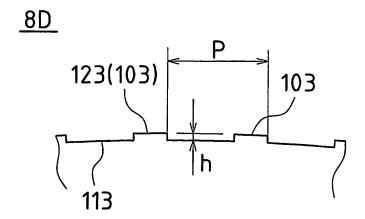
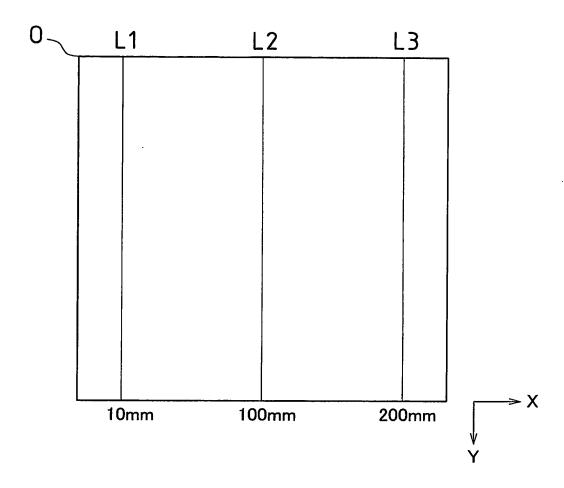


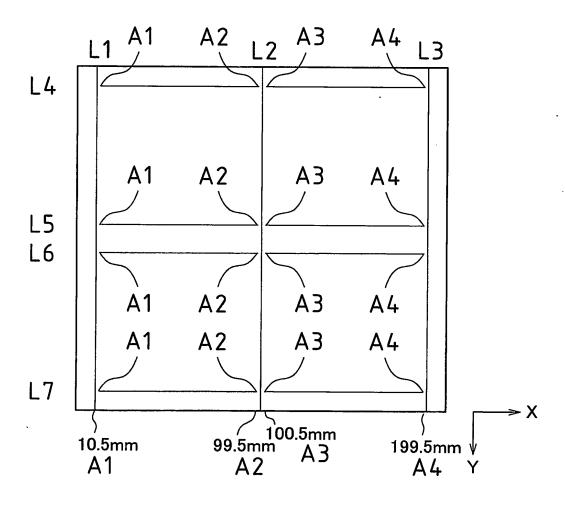
図5



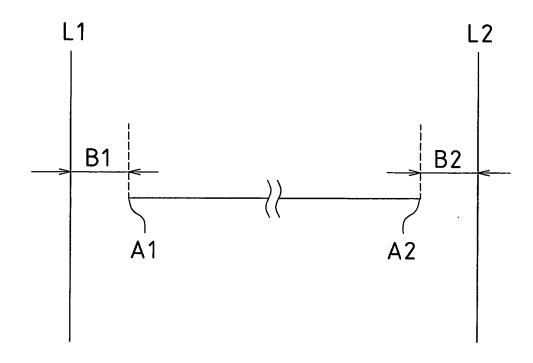












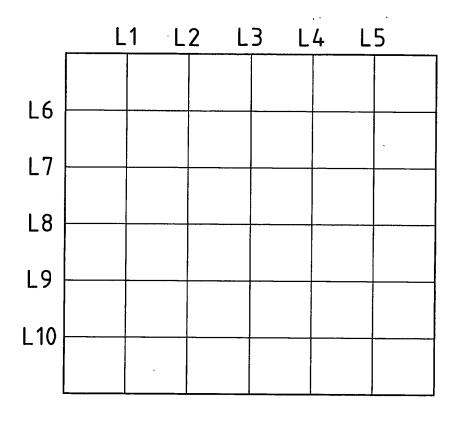
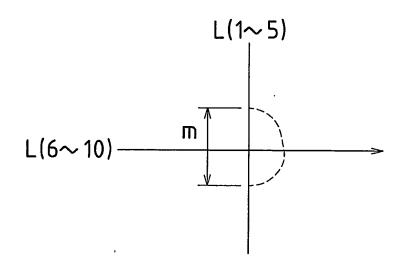
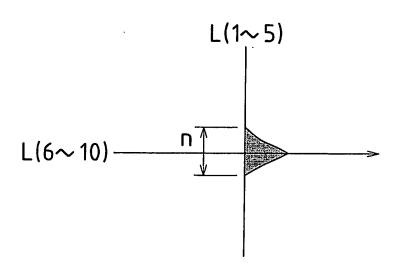


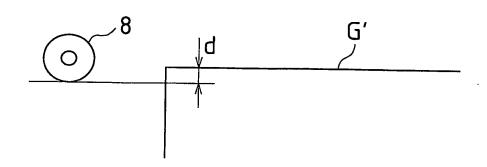
図11

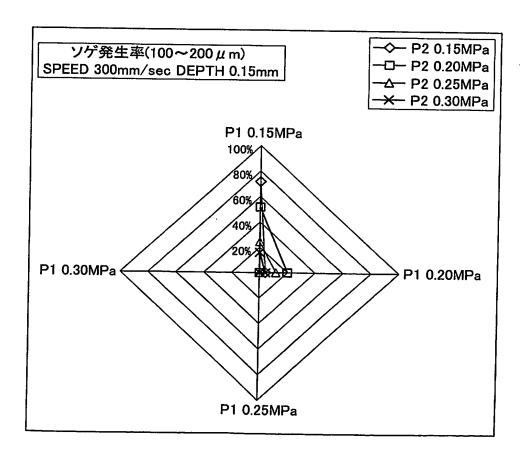




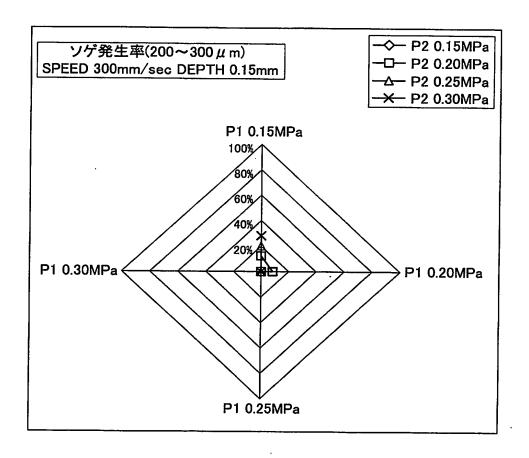
10/23

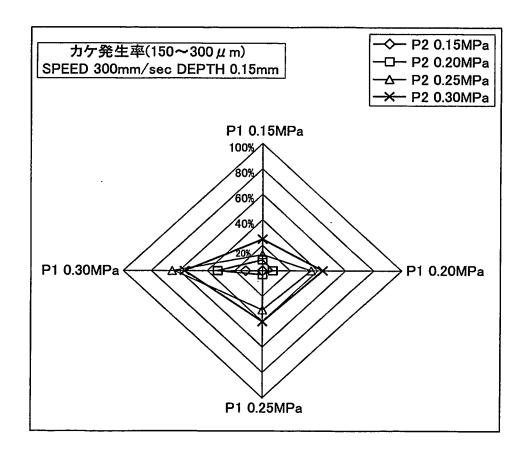
図13

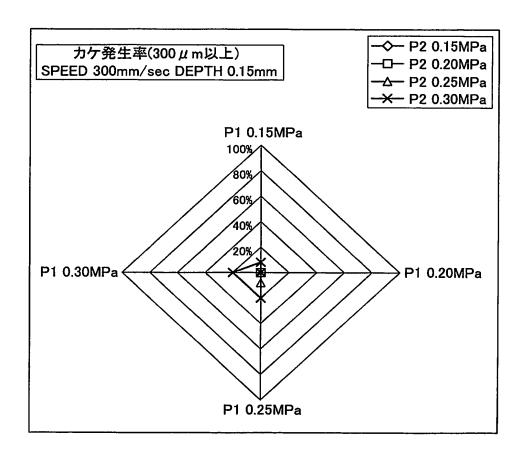


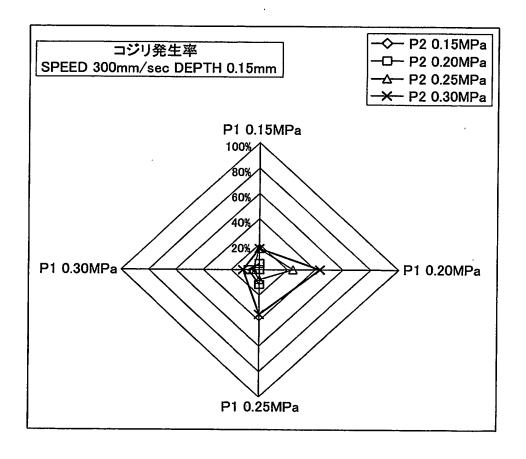


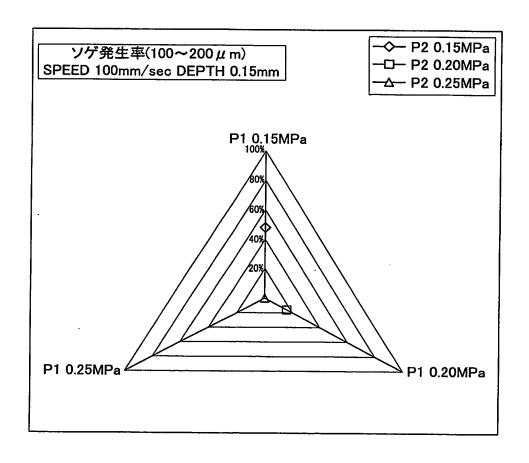
差 換 え 用 紙 (規則26)

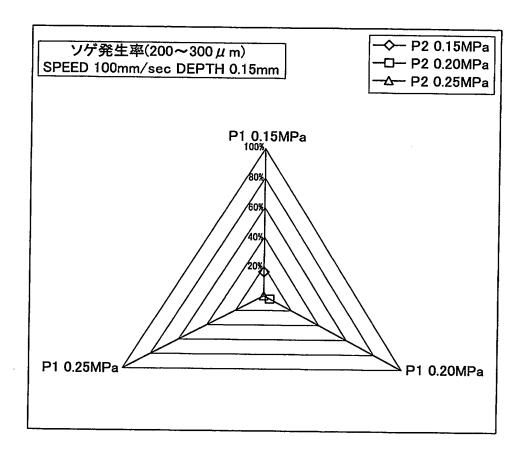


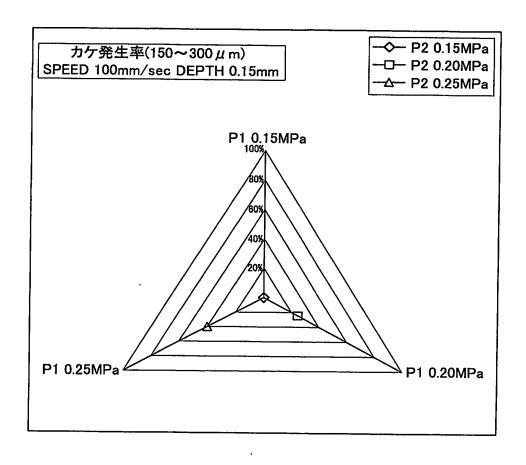


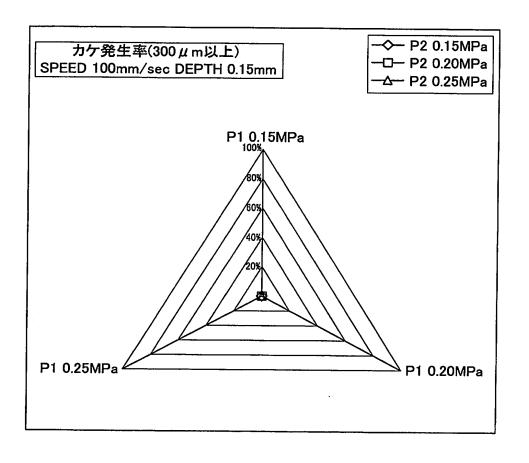












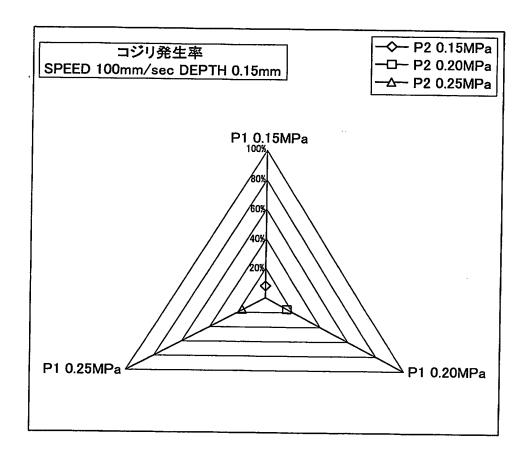
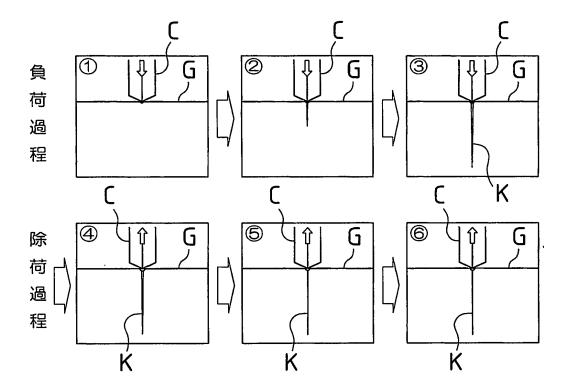
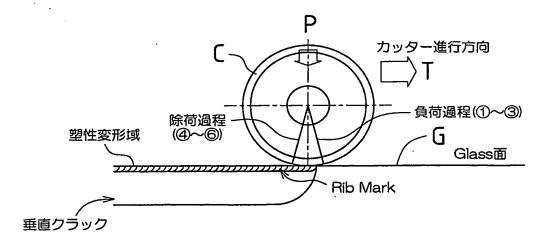
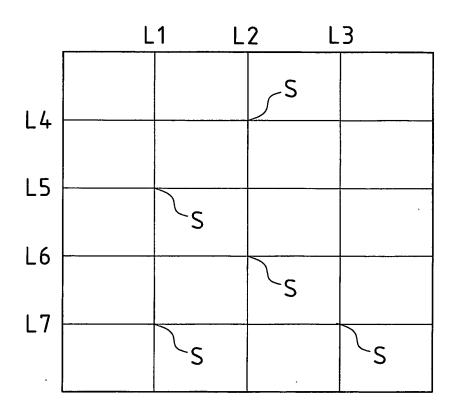


図24







22/23



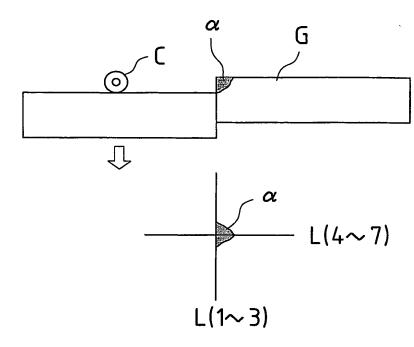
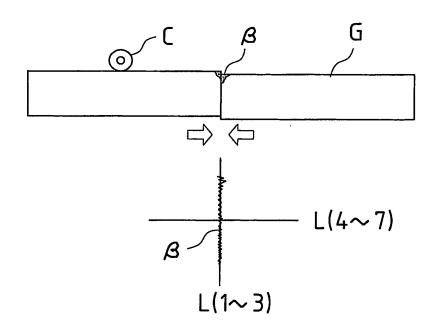
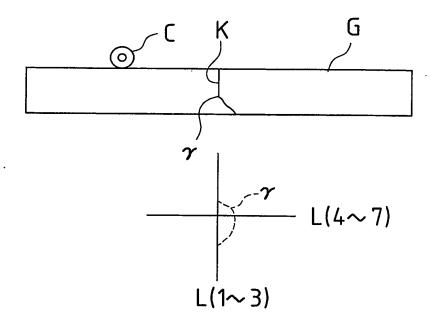


図28







International application No.
PCT/JP03/13587

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ B28D5/00, C03B33/027						
	o International Patent Classification (IPC) or to both na	ational classification and IPC				
	S SEARCHED					
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ B28D5/00, C03B33/027						
Documentat	tion searched other than minimum documentation to the	e extent that such documents are included	in the fields searched			
Jitsu Kokai	uyo Shinan Koho 1926—1996 i Jitsuyo Shinan Koho 1971—1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho Jitsuyo Shinan Toroku Koho	o 1994–2003 o 1996–2003			
Electronic d	lata base consulted during the international search (nam	ne of data base and, where practicable, sea	rch terms used)			
2 Poch						
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		- <u></u>			
Category*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.			
A	JP 2001-328833 A (Mitsuboshi Co., Ltd.), 27 November, 2001 (27.11.01), (Family: none)	Diamond Industrial	1-4			
A	Co., Ltd.), 17 November, 1998 (17.11.98),	amond Industrial	1-4			
A	JP 11-157860 A (Kabushiki Ka 15 June, 1999 (15.06.99), (Family: none)	isha Berudekkusu),	. 1-4			
	i					
X Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	<u> </u>			
	l categories of cited documents:	"T" later document published after the inte				
conside	ent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance	priority date and not in conflict with the understand the principle or theory und-				
"E" earlier	document but published on or after the international filing	"X" document of particular relevance; the	claimed invention cannot be			
"L" docume	ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or cannot be conside step when the document is taken alone	e			
cited to special	o establish the publication date of another citation or other reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive step				
"O" docume	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	combined with one or more other such	documents, such			
means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "Combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family						
Date of the actual completion of the international search 19 November, 2003 (19.11.03) Date of mailing of the international search report 02 December, 2003 (02.12.03)						
	nailing address of the ISA/	Authorized officer				
_	nese Patent Office					
Facsimile No.		Telephone No.				



Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1998)

International application No.
PCT/JP03/13587

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No			
A	JP 10-214997 A (Sanyo Electric Co., Ltd.), 11 August, 1998 (11.08.98), (Family: none)	1-4			
A .	US 5286343 A (Regents of the University of California), 15 February, 1994 (15.02.94), (Family: none)	1-4			

:				
	国際調査	国際出願番号	T/JP0	3/13587
A. 発明の原	属する分野の分類(国際特許分類(IPC))			
Int. Cl	⁷ B28D5/00, C03B33/027			
	すった分野			
調査を行った最	是小限資料(国際特許分類(IPC))			
Int. Cl	⁷ B28D5/00, C03B33/027			
	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの			
日本国実用新日本国公開宝	案公報			
日本国登録実	用新案公報 1994-2003			
日本国実用新 	案登録公報 1996-2003			
国際調査で使用	目した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)		
		•		
	ると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	こきは、その関連する箇所	听の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2001-328833 A	(三星ダイヤモン	ド工業株式	1 - 4
	会社) 2001.11.27 (ファミリーなし)		
A	US 5836229 A (Mi	+ a	D:	7 4
71	nd Industrial Co.			1-4
	1.17 & EP 773194			
	534 A		ĺ	
A	JP 11-157860 A (株	生さ合社 ベルデッ	クス) 1	7 4
	999.06.15 (ファミリー			1-4
— Inn - 111				
X C欄の続き	だにも文献が列挙されている。	□ パテントファミ	リーに関する別	紙を参照。
* 引用文献の		の日の後に公表さ		
・A」特に関連 もの	極のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は個出願と矛盾するも		された文献であって E明の原理又は理論
	負目前の出願または特許であるが、国際出願日	の理解のために引	用するもの	
	注表されたもの E張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	「X」特に関連のあるが の新規性又は進歩		
日若しく	は他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のあるプ	て献であって、当	当該文献と他の1以
「〇」口頭によ	≣ ≘を付す) こる開示、使用、展示等に言及する文献	上の又献との、当 よって進歩性がな		目明である組合せに ちもの
「P」国際出願 	頁日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	「&」同一パテントファ		
国際調査を完了	19.11.03	国際調査報告の発送日	02.12.0	3
	0名称及びあて先	特許庁審査官(権限のあ		3P 8207
日本国	国特許庁(ISA/JP)	千葉 月		1 1

電話番号 03-3581-1101 内線 3362

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1998年7月)

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

国際出願番号 T/JP03/13587

	国际出願番号	FC1/ JP0	3/13587
C(続き).	関連すると認められる文献		
引用文献の			関連する
カテゴリー*		箇所の表示	請求の範囲の番号
A	JP 10-214997 A (三洋電機株式会社)	199	1-4
	8.08.11 (ファミリーなし)		
A	US 5286343 A (Regents of	the II	1 - 4
	niversity of California)	1994	1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	02.15 (ファミリーなし)	1004.	
]			
		i	
		İ	
[j
1		1	
	·		ŀ
		}	
ļ			
			Į
		ĺ	
		1	
1			
		ļ	
j		İ	
į			
1			
1			İ
į			
I			1
		ľ	
1		1	
		1	
		1	
		1	
	·		
1		{	
##-+ D O D / I		L	